【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公表番号】特表2004-538367(P2004-538367A)
【公表日】平成16年12月24日(2004.12.24)
【年通号数】公開・登録公報2004-050
【出願番号】特願2003-519960(P2003-519960)
【国際特許分類第７版】
　Ｃ２３Ｃ　16/511
　Ｈ０１Ｐ　 5/12
　Ｈ０５Ｈ　 1/46
【ＦＩ】
　Ｃ２３Ｃ　16/511
　Ｈ０１Ｐ　 5/12　　Ａ
　Ｈ０５Ｈ　 1/46　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成16年10月19日(2004.10.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品をコーティングする装置であって、
　単一のマイクロ波源および、
　２つ以上のコーティング室（１０、１０’）を有し、
　前記コーティング室（１０、１０’）はすべて単一のマイクロ波源に接続され、
　マイクロ波エネルギーを分割して前記個々のコーティング室（１０、１０’）にプラズマを発生させ、インピーダンス構造または導波管構造を有する、物品をコーティングする装置。
【請求項２】
　前記導波管構造は、マイクロ波エネルギーを分割する少なくとも１つの部品を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　マイクロ波エネルギーを分割する部品は、ｙ－分割器である、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記導波管構造は矩形導波管を含む、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記導波管構造は円形導波管を含む、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　前記導波管構造は、前記コーティング室それぞれにマイクロ波エネルギーを導入する誘電体窓または同軸導体構造を含む、請求項１ないし５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記インピーダンス構造は、マイクロ波エネルギーを分割する少なくとも１つの部品を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記インピーダンス構造は、金属内部導体（Ａ）および外部導体としての誘電体（Ｂ）

を備える１つの同軸導体構造をそれぞれ備え、マイクロ波エネルギーを前記個々のコーティング室（１０、１０’）に導入する、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
前記内部導体（Ａ）の電気長を変える手段（５、５’；６、６’）が設けられる、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
前記同軸導体構造は、前記マイクロ波源と分岐点との間に接続部を形成する、第１の導体部（２）を備える、請求項８または９に記載の装置。
【請求項１１】
ウェブ（３）および２つのリム（４、４’）を含むＨ字形導体構造が少なくとも２つの処理室（１０、１０’）の上流に接続され、
前記ウェブ（３）は、入力導体（２）を介して前記マイクロ波源に接続され、
前記Ｈ字形導体構造の各リム（４、４’）は、対応する前記処理室（１０、１０’）から隔たっているリム部（４．１、４．１’）および該処理室（１０、１０’）の１つに面するリム部（４．２、４．２’）を有する
ことを特徴とする、請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
前記対応する処理室（１０、１０’）から遠隔している前記リム部の電気長は、調整可能である、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
前記入力導体部（２）の電気長も調整可能である、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
前記電気長を調整する手段は、前記内部導体（Ａ）を囲む変位可能スリーブから形成される、請求項１２または１３に記載の装置。
【請求項１５】
前記内部導体（Ａ）の前記電気長を調整する手段は、前記内部導体（Ａ）にねじ込むことができるねじから形成される、請求項１１ないし１４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
前記ウェブ（３）は、追加のリム（７）に接続される、請求項１１ないし１４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１７】
前記追加のリム（７）は、前記２つのリム（４、４’）間で前記ウェブ（３）の中央付近に接続される、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
前記追加のリム（７）の電気長も調整可能である、請求項１６または１７に記載の装置。
【請求項１９】
前記Ｈ字形導体構造は、導波管および／または同軸導体を含む、請求項１１ないし１８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２０】
前記コーティング室（１０、１０’）は、互いに離れて配置され、特に互いに遮蔽されている、請求項１ないし１９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２１】
コーティングされる物品はそれぞれ、前記個々のコーティング室（１０、１０’）に収容されるか、あるいは、前記コーティング室（１０、１０’）はそれぞれ、物品により形成される、請求項１ないし請求項２０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２２】
前記個々のコーティング室は、別個の真空供給デバイスおよびガス供給デバイスを割り当てられる、請求項１ないし請求項２１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２３】

前記コーティング室はそれぞれ、前記プラズマまたはコーティングされるべき基材から発生する熱放射および／または電磁放射を記録する別個の検知ユニットを割り当てられる、請求項１ないし２２のいずれか１項に記載の装置。

【請求項２４】

パルス状または非パルス状時間変調エネルギーの供給、特にパルス状マイクロ波源が提供される、請求項１ないし２３のいずれか１項に記載の装置。

【請求項２５】

前記インピーダンス構造または前記導波管構造は、剛性導体を備える、請求項１ないし２４のいずれか１項に記載の装置。